

有害事業廢棄物認定標準修正草案總說明

「有害事業廢棄物認定標準」(以下簡稱本標準)訂定於七十六年五月十二日，嗣後歷經十次修正，現行規定係於九十八年六月五日修正發布。本次修正係進行實務調整，與國際有害事業廢棄物管制方式接軌，同時配合國內廢棄物處理及再利用產業之提升，將部分有害事業廢棄物改列一般事業廢棄物，以促進廢棄物資源再生利用，並落實國家永續發展政策。其修正要點如次：

- 一、明定本標準適用對象。(修正條文第二條)
- 二、修正附表一製程有害事業廢棄物，增列「製造二氯乙烯或氯乙烯單體之廢水處理污泥」。刪除附表二混合五金廢料之規定，並配合將原附表二第十三項含鈹、銻、碲、鉈金屬廢料、第十四項發光二極體晶圓廢料及粉屑移列至附表一製程有害事業廢棄物，其餘十二個廢棄物項目，回歸一般事業廢棄物管制。(修正條文第三條)
- 三、將原生物醫療廢棄物用詞修正為醫療有害廢棄物，以資明確。(修正條文第三條)
- 四、將現行第四條之戴奧辛、多氯聯苯、石棉等有害事業廢棄物，移列至新增之第五條其他有害事業廢棄物。另修正附表三毒性特性溶出程序(TCLP)溶出標準三(九)，增列「混合五金廢料處理後之殘餘物」為管制對象。(修正條文第四條、新增條文第五條)
- 五、刪除現行第五條規定之「表列排除判定程序與排除標準值」，並明定「製程有害事業廢棄物排除認定申請書」及切結聲明，由事業向所在地主管機關申請排除認定。(修正條文第六條)

有害事業廢棄物認定標準修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條 本標準依廢棄物清理法(以下簡稱本法)第二條第二項規定訂定之。	第一條 本標準依廢棄物清理法(以下簡稱本法)第二條第二項規定訂定之。	本條未修正。
第二條 <u>事業所產生之廢棄物應依所定方式，認定是否為有害事業廢棄物。</u> 有害事業廢棄物以下列方式依序認定： 一、 <u>第三條所訂列表之有害事業廢棄物。</u> 二、 <u>第四條之特性認定有害事業廢棄物。</u> 三、 <u>第五條之其他有害事業廢棄物。</u> 四、 <u>其他經中央主管機關公告者。</u>	第二條 有害事業廢棄物以下列方式依序判定： 一、列表之有害事業廢棄物。 二、有害特性認定之有害事業廢棄物。 三、其他經中央主管機關公告者。	一、明定本標準適用對象為事業廢棄物。 二、配合本標準第三條至第五條之修正，予以調整款次。
第三條 列表之有害事業廢棄物種類如下： 一、製程有害事業廢棄物：指附表一 <u>所列製程產生之廢棄物，且含有表列成分者。</u> 二、 <u>醫療有害廢棄物</u> ：指醫療機構、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠，於醫療、醫事檢驗、驗屍、檢疫、研究、藥品或生物材料製造過程中產生附表二所列之廢棄物。	第三條 列表之有害事業廢棄物種類如下： 一、製程有害事業廢棄物：指附表一 <u>所列製程產生之廢棄物。</u> 二、 <u>混合五金廢料</u> ：依 <u>貯存、清除、處理及輸出入等清理階段危害特性判定，其認定方式如附表二。</u> 三、 <u>生物醫療廢棄物</u> ：指醫療機構、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠，於醫療、醫事檢驗、驗屍、檢疫、研究、藥品或生物材料製造過程中產生附表三所列之廢棄物。	一、明確定義製程產生之廢棄物含有附表一 <u>所列成分者</u> ，屬製程有害事業廢棄物。 二、為與國際管制方式接軌，並促進廢棄物資源再生利用，爰刪除第二款混合五金廢料之列管。 三、第三款生物醫療廢棄物所稱「生物」，有致誤解為所有生物之虞，爰酌作文字修正。 四、附表表次變更。
第四條 特性認定有害事業廢棄物種類如下： 一、 <u>含毒性化學物質之有害事業廢棄物</u> ：	第四條 <u>有害特性認定之有害事業廢棄物</u> 種類如下： 一、 <u>毒性有害事業廢棄物</u> ： (一)依毒性化學物質管理法	一、酌修文字如下，以資明確： (一)第一項修正「有害特性認定之有害事業廢棄物」為「特性認定有害事業廢棄物」。

<p>(一)依毒性化學物質管理法公告之第一類、第二類及第三類毒性化學物質之固體或液體廢棄物。</p> <p>(二)直接接觸前目毒性化學物質之廢棄盛裝容器。</p> <p>二、溶出毒性有害事業廢棄物：指事業廢棄物依使用原物料、製程及廢棄物成分特性之相關性選定分析項目，以毒性特性溶出程序(以下簡稱 TCLP)檢測，其成分濃度超過附表三之標準者。</p> <p>三、腐蝕性有害事業廢棄物：指事業廢棄物具有下列性質之一者：</p> <p>(一)廢液氫離子濃度指數(pH 值)大於等於十二·五或小於等於二·〇；或在攝氏溫度五十五度時對鋼(中華民國國家標準鋼材 S 二〇 C)之腐蝕速率每年超過六·三五毫米者。</p> <p>(二)固體廢棄物於溶液狀態下氫離子濃度指數(pH 值)大於等於十二·五或小於等於二·〇；或在攝氏溫度五十五度時對鋼(中華民國國家標準鋼材 S 二〇 C)之腐蝕速率每年超過六·三五毫米者。</p> <p>四、易燃性有害事業廢棄物：指事業廢棄物具有下列性質之一者：</p> <p>(一)廢液閃火點小於攝氏溫度六十度者。但不包括乙醇體積濃度小於百分之二十四之酒類廢棄物。</p> <p>(二)固體廢棄物於攝氏溫度二十五度加減二度、一大氣壓下(以下簡稱常溫常壓)可因摩擦、吸水或自發性化學反應而起火燃</p>	<p>公告之第一類、第二類及第三類毒性化學物質之固體或液體廢棄物。</p> <p>(二)直接接觸前目毒性化學物質之廢棄盛裝容器。</p> <p>二、溶出毒性事業廢棄物：指事業廢棄物依使用原物料、製程及廢棄物成分特性之相關性選定分析項目，以毒性特性溶出程序(以下簡稱 TCLP)直接判定或先經萃取處理再判定之萃出液，其成分濃度超過附表四之標準者。</p> <p>三、戴奧辛有害事業廢棄物：指事業廢棄物中含 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物之總毒性當量濃度超過一·〇 ng I-TEQ/g 者。</p> <p>四、多氯聯苯有害事業廢棄物：指多氯聯苯重量含量在百萬分之五十以上之廢電容器(以絕緣油重量計)、廢變壓器(以變壓器油重量計)或其他事業廢棄物。</p> <p>五、腐蝕性事業廢棄物：指事業廢棄物具有下列性質之一者：</p> <p>(一)廢液氫離子濃度指數(pH 值)大於等於十二·五或小於等於二·〇；或在攝氏溫度五十五度時對鋼(中華民國國家標準鋼材 S 二〇 C)之腐蝕速率每年超過六·三五毫米者。</p> <p>(二)固體廢棄物於溶液狀態下氫離子濃度指數(pH 值)大於等於十二·五或小於等於二·〇；或在攝氏溫度五十五度時對鋼(中華民國國家標準鋼材 S 二〇 C)之腐蝕速率每年超過六·三五毫米者。</p>	<p>(二)第一款修正「毒性有害事業廢棄物」為「含毒性化學物質之有害事業廢棄物」。</p> <p>(三)第二款修正「溶出毒性事業廢棄物」為「溶出毒性有害事業廢棄物」，並予明確定義。</p> <p>(四)第五款修正「腐蝕性事業廢棄物」為「腐蝕性有害事業廢棄物」。</p> <p>(五)第六款修正「易燃性事業廢棄物」為「易燃性有害事業廢棄物」。</p> <p>(六)第七款修正「反應性事業廢棄物」為「反應性有害事業廢棄物」。</p> <p>三、第三款、第四款及第八款戴奧辛、多氯聯苯、石棉等有害事業廢棄物，移列至第五條。</p>
--	---	--

<p>燒引起危害者。</p> <p>(三)可直接釋出氧、激發物質燃燒之廢強氧化劑。</p> <p><u>五、反應性有害事業廢棄物</u>：指事業廢棄物具有下列性質之一者：</p> <p>(一)常溫常壓下易產生爆炸者。</p> <p>(二)與水混合會產生劇烈反應或爆炸之物質或其混合物。</p> <p>(三)含氰化物且其氫離子濃度指數(pH 值)於二·〇至十二·五間，會產生二五〇 mg HCN/kg 以上之有毒氣體者。</p> <p>(四)含硫化物且其氫離子濃度指數(pH 值)於二·〇至十二·五間，會產生五〇〇 mg H₂S/kg 以上之有毒氣體者。</p>	<p>六、易燃性事業廢棄物：指事業廢棄物具有下列性質之一者：</p> <p>(一)廢液閃火點小於攝氏溫度六十度者。但不包括乙醇體積濃度小於百分之二十四之酒類廢棄物。</p> <p>(二)固體廢棄物於攝氏溫度二十五度加減二度、一大氣壓下(以下簡稱常溫常壓)可因摩擦、吸水或自發性化學反應而起火燃燒引起危害者。</p> <p>(三)可直接釋出氧、激發物質燃燒之廢強氧化劑。</p> <p>七、反應性事業廢棄物：指事業廢棄物具有下列性質之一者：</p> <p>(一)常溫常壓下易產生爆炸者。</p> <p>(二)與水混合會產生劇烈反應或爆炸之物質或其混合物。</p> <p>(三)含氰化物且其氫離子濃度指數(pH 值)於二·〇至十二·五間，會產生二五〇 mg HCN/kg 以上之有毒氣體者。</p> <p>(四)含硫化物且其氫離子濃度指數(pH 值)於二·〇至十二·五間，會產生五〇〇 mg H₂S/kg 以上之有毒氣體者。</p> <p>八、石綿及其製品廢棄物：指事業廢棄物具有下列性質之一者：</p> <p>(一)製造含石綿之防火、隔熱、保溫材料及煞車來令片等磨擦材料研磨、修邊、鑽孔等加工過程中產生易飛散性之廢棄物。</p> <p>(二)施工過程中吹噴石綿所產生之廢棄物。</p> <p>(三)更新或移除使用含石綿</p>	
---	---	--

	<p>之防火、隔熱、保溫材料及煞車來令片等過程中，所產生易飛散性之廢棄物。</p> <p>(四)盛裝石綿原料袋。</p> <p>(五)其他含有百分之一以上石綿且具有易飛散性質之廢棄物。</p>	
<p>第五條 其他有害事業廢棄物種類如下：</p> <p>一、戴奧辛有害事業廢棄物：指事業廢棄物中含2,3,7,8-氯化戴奧辛及呔喃同源物等十七種化合物之總毒性當量濃度超過一·〇 ng I-TEQ/g者。</p> <p>二、多氯聯苯有害事業廢棄物：指多氯聯苯重量含量在百萬分之五十以上之廢電容器(以絕緣油重量計)、廢變壓器(以變壓器油重量計)或其他事業廢棄物。</p> <p>三、石綿有害事業廢棄物：指下列具易飛散性質之石綿纖維或粉塵之廢棄物：</p> <p>(一)製造含石綿之防火、隔熱、保溫材料及煞車來令片等磨擦材料研磨、修邊、鑽孔等加工過程中產生易飛散性之廢棄物。</p> <p>(二)施工過程中吹噴石綿所產生之廢棄物。</p> <p>(三)更新或移除使用含石綿之防火、隔熱、保溫材料及煞車來令片等過程中，所產生易飛散性之廢棄物。</p> <p>(四)盛裝石綿原料袋。</p> <p>(五)其他含有百分之一以上石綿且具有易飛散性質之廢棄物。</p>	<p>第五條 有害事業廢棄物符合下列規定者，得改列或認定為一般事業廢棄物：</p> <p>一、<u>第三條第一款附表一所列之有害事業廢棄物，事業得檢具下列文件，向所在地主管機關申請表列排除核准後，得改列為一般事業廢棄物。表列排除判定程序與排除標準值，由中央主管機關公告之：</u></p> <p>(一)<u>事業之公司登記證明文件或商業登記證明文件。</u></p> <p>(二)<u>有害事業廢棄物表列排除申請書。</u></p> <p>(三)<u>廢棄物採樣計畫書。</u></p> <p>(四)<u>廢棄物特性、組成及成分分析之檢測報告。</u></p> <p>(五)<u>其他經主管機關指定之文件。</u></p> <p>二、<u>第三條及前條之有害事業廢棄物依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準之中間處理方式處理，其有害性質消失者，得認定為一般事業廢棄物。</u></p> <p>三、<u>前條第六款第一目之廢液不具下列性質且採焚化或熱處理者，得認定為一般事業廢棄物。但處理前之貯存、清除，應符合有害事業廢棄物相關規定：</u></p> <p>(一)製程有害事業廢棄物。</p> <p>(二)毒性有害事業廢棄物。</p> <p>(三)溶出毒性事業廢棄物。</p> <p>(四)戴奧辛有害事業廢棄物。</p>	<p>一、原第四條第三款、第四款及第八款戴奧辛、多氯聯苯、石綿等有害事業廢棄物，移列至本條。原第五條移列至第六條。</p> <p>二、第一款修正「戴奧辛有害事業廢棄物」用語為「戴奧辛有害事業廢棄物」。</p> <p>三、第二款修正「多氯聯苯有害事業廢棄物」用語為「多氯聯苯有害事業廢棄物」。</p> <p>四、第三款修正「石綿及其製品廢棄物」用語為「石綿有害事業廢棄物」。</p>

	<p>(五)多氯聯苯有害事業廢棄物。</p> <p>(六)腐蝕性事業廢棄物。</p> <p>(七)反應性事業廢棄物。</p> <p>(八)其他經中央主管機關指定者。</p>	
<p><u>第六條</u> 有害事業廢棄物符合下列規定者，得改認定為一般事業廢棄物：</p> <p>一、<u>第三條第一款附表一</u>所列之有害事業廢棄物，事業得檢具<u>製程有害事業廢棄物排除認定申請書</u>(如附件)，送所在地主管機關<u>審查核准</u>。</p> <p>二、<u>前三條</u>之有害事業廢棄物依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準之處理方式處理，其有害性質消失者。</p> <p>三、<u>第四條第四款第一目</u>之廢液不具下列性質且採焚化或熱處理。但處理前之貯存、清除，應符合有害事業廢棄物相關規定：</p> <p>(一)製程有害事業廢棄物。</p> <p>(二)<u>含毒性化學物質</u>之有害事業廢棄物。</p> <p>(三)<u>溶出毒性有害</u>事業廢棄物。</p> <p>(四)戴奧辛有害事業廢棄物。</p> <p>(五)多氯聯苯有害事業廢棄物。</p> <p>(六)腐蝕性有害事業廢棄物。</p> <p>(七)反應性有害事業廢棄物。</p> <p>(八)其他經中央主管機關指定者。</p>	<p><u>第六條</u> 本標準修正前已審查核准之事業廢棄物清理計畫書或依本法取得之事業廢棄物清除、處理、清理或再利用之相關許可，其審查核准或許可內容於本標準修正施行後應辦理變更或異動者，應於本標準發布施行後一年內完成變更或異動。</p> <p>因本標準修正而須增設之相關設施，於本標準發布後一年內應完成設置。</p>	<p>一、原第六條相關異動回歸廢棄物清理計畫書規定辦理變更、異動；事業廢棄物清除、處理或再利用之相關許可，則回歸相關規定辦理審查，予以刪除。</p> <p>二、原第五條移列至本條，並酌作文字修正。</p> <p>三、鑒於經母法明文規定授權行政機關方可自行訂定法規命令，且因有害事業廢棄物種類龐雜，如欲逐一訂定相關管制標準值，恐生掛一漏萬情形，第一款刪除「表列排除判定程序與排除標準值」之規定，並明定製程有害事業廢棄物排除認定申請書格式，由所在地主管機關以個案審核。</p> <p>四、第二款配合「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」修正方向，修正「中間處理」為「處理」。</p> <p>五、第三款配合修正條次及條文文字。</p>
<p><u>第七條</u> 本標準<u>施行日期自發布後一年施行</u>。</p>	<p><u>第七條</u> 本標準自發布日施行。</p>	<p>就修正條文給予適度緩衝期，以資周妥。</p>

有害事業廢棄物認定標準第三條附表一修正條文對照表

修正規定					現行規定					說明
附表一、製程有害事業廢棄物					附表一、製程有害事業廢棄物					
行業別	製程產生之廢棄物	成分		危害性 ^(註)	行業別	製程產生之廢棄物	成分		危害性 ^(註)	
		中文	英文				中文	英文		
基本化學工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、以汞電極法製氣之廢水處理污泥	汞	mercury.	(T)	基本化學工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、以汞電極法製氣之廢水處理污泥	汞	mercury.	(T)	
	二、製造甲乙基吡啶之汽提塔殘留物	三聚乙醛、吡啶類、2-皮考林	paraldehyde; pyridines; 2-picoline.	(T)		二、製造甲乙基吡啶之汽提塔殘留物	三聚乙醛、吡啶類、2-皮考林	paraldehyde; pyridines; 2-picoline.	(T)	
	三、製造苯胺之蒸餾殘留物	苯胺、二苯胺、硝基苯、苯二胺	aniline; diphenylamine; nitrobenzene; phenylenediamine.	(T)		三、製造苯胺之蒸餾殘留物	苯胺、二苯胺、硝基苯、苯二胺	aniline; diphenylamine; nitrobenzene; phenylenediamine.	(T)	
	四、製造苯胺之萃取殘留物	苯胺、硝基苯、苯二胺	aniline; nitrobenzene; phenylenediamine.	(T)		四、製造苯胺之萃取殘留物	苯胺、硝基苯、苯二胺	aniline; nitrobenzene; phenylenediamine.	(T)	
	五、製造硝基苯及苯胺之混合廢液	苯胺、苯、二苯胺、苯二胺	aniline; benzene; diphenylamine; phenylenediamine.	(T)		五、製造硝基苯及苯胺之混合廢液	苯胺、苯、二苯胺、苯二胺	aniline; benzene; diphenylamine; phenylenediamine.	(T)	
	六、製造氯苯之水洗步驟分流液、蒸餾或分餾塔殘留物	苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯、六氯苯、氯苯	benzene; dichlorobenzene; trichlorobenzene; tetrachlorobenzene; pentachlorobenzene; hexachlorobenzene; chlorobenzene.	(T)		六、製造氯苯之水洗步驟分流液、蒸餾或分餾塔殘留物	苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯、六氯苯、氯苯	benzene; dichlorobenzene; trichlorobenzene; tetrachlorobenzene; pentachlorobenzene; hexachlorobenzene; chlorobenzene.	(T)	

修正規定				現行規定				說明
七、製造氯苯清洗反應器之廢液	苯、氯苯、二氯苯、2,4,6-三氯酚	benzene; chlorobenzene; dichlorobenzene; 2,4,6,-trichlorophenol.	(T)	七、製造氯苯清洗反應器之廢液	苯、氯苯、二氯苯、2,4,6-三氯酚	benzene; chlorobenzene; dichlorobenzene; 2,4,6,-trichlorophenol.	(T)	
八、以甲苯硝化製造二硝基甲苯之廢液	2,4-二硝基甲苯	2,4-Dinitrotoluene.	(C) (T)	八、以甲苯硝化製造二硝基甲苯之廢液	2,4-二硝基甲苯	2,4-Dinitrotoluene.	(C) (T)	
九、以乙烯溴化製造二溴乙烷之滌氣塔廢液	二溴乙烷	Ethylene dibromide	(T)	九、以乙烯溴化製造二溴乙烷之滌氣塔廢液	二溴乙烷	Ethylene dibromide	(T)	
十、同九製程中純化二溴乙烷產生之廢吸收劑	二溴乙烷	Ethylene dibromide	(T)	十、同九製程中純化二溴乙烷產生之廢吸收劑	二溴乙烷	Ethylene dibromide	(T)	
十一、同九製程中純化二溴乙烷產生之蒸餾殘渣	二溴乙烷	Ethylene dibromide	(T)	十一、同九製程中純化二溴乙烷產生之蒸餾殘渣	二溴乙烷	Ethylene dibromide	(T)	
十二、以硝化苯的製程生產硝基苯之蒸餾殘渣	間-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯	m-dinitrobenzene; 2,4-dintrotoluene.	(T)	十二、以硝化苯的製程生產硝基苯之蒸餾殘渣	間-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯	m-dinitrobenzene; 2,4-dintrotoluene.	(T)	
十三、生產二異氰酸甲苯之離心或蒸餾殘渣	二異氰酸甲苯、2,4-二胺甲苯	toluene diisocyanate; toluene-2,4-diamine.	(R) (T)	十三、生產二異氰酸甲苯之離心或蒸餾殘渣	二異氰酸甲苯、2,4-二胺甲苯	toluene diisocyanate; toluene-2,4-diamine.	(R) (T)	

修正規定				現行規定				說明
十四、以碳酸聯胺生產1,1-二甲基聯胺(UDMH)之分離底渣、氣體濃縮底渣及廢過濾器	1,1-二甲基聯胺	1,1-dimethylhydrazine (UDMH).	(C) (I) (T)	十四、以碳酸聯胺生產1,1-二甲基聯胺(UDMH)之分離底渣、氣體濃縮底渣及廢過濾器	1,1-二甲基聯胺	1,1-dimethylhydrazine (UDMH).	(C) (I) (T)	
十五、用氫化二甲基甲苯生產二胺甲苯的乾燥柱反應廢液、輕質或重質殘渣	2,4-二胺甲苯,鄰-甲苯胺、對-甲苯胺	2,4-toluenediamine; o-toluidine; p-toluidine;	(T)	十五、用氫化二甲基甲苯生產二胺甲苯的乾燥柱反應廢液、輕質或重質殘渣	2,4-二胺甲苯,鄰-甲苯胺、對-甲苯胺	2,4-toluenediamine; o-toluidine; p-toluidine;	(T)	
十六、以二胺甲苯光氣法生產二異氰酸鹽之溶劑回收有機濃縮物	四氯化碳、四氯乙烯、氯仿、光氣	carbon tetrachloride; tetrachloroethylene; chloroform; phosgene.	(T)	十六、以二胺甲苯光氣法生產二異氰酸鹽之溶劑回收有機濃縮物	四氯化碳、四氯乙烯、氯仿、光氣	carbon tetrachloride; tetrachloroethylene; chloroform; phosgene.	(T)	
十七、生產2,4,6-三溴酚之地板清掃物、廢產品和廢過濾物	2,4,6-三溴酚	2,4,6-tribromophenol.	(T)	十七、生產2,4,6-三溴酚之地板清掃物、廢產品和廢過濾物	2,4,6-三溴酚	2,4,6-tribromophenol.	(T)	

修正規定				現行規定				說明		
	十八、生產 α -（或甲基）氯甲苯、環氯甲苯、氯化苯和其官能基之混合物之蒸餾底渣	三氯苯、氯苯、氯仿、氯化甲烷、氯苯、1,4-二氯苯、六氯苯、五氯苯、1,2,4,5-四氯乙烯、甲苯、四氯化碳	benotrichloride; chlorobenzene; chloroform; chloromethane; 1,4-dichlorobenzene; hexachlorobenzene; pentachlorobenzene; 1,2,4,5-tetrachloroethylene; toluene; carbon tetrachloride.	(T)		十八、生產 α -（或甲基）氯甲苯、環氯甲苯、氯化苯和其官能基之混合物之蒸餾底渣	三氯苯、氯苯、氯仿、氯化甲烷、氯苯、1,4-二氯苯、六氯苯、五氯苯、1,2,4,5-四氯乙烯、甲苯、四氯化碳	benotrichloride; chlorobenzene; chloroform; chloromethane; 1,4-dichlorobenzene; hexachlorobenzene; pentachlorobenzene; 1,2,4,5-tetrachloroethylene; toluene; carbon tetrachloride.	(T)	
	十九、以石墨作為陽極之橫隔製程純化氯所產生之含氯碳氫廢棄物	氯仿、四氯化碳、六氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷	chloroform; carbon tetrachloride; hexachloroethane; trichloroethane; tetrachloroethylene; 1,2-dichloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane.	(T)		十九、以石墨作為陽極之橫隔製程純化氯所產生之含氯碳氫廢棄物	氯仿、四氯化碳、六氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷	chloroform; carbon tetrachloride; hexachloroethane; trichloroethane; tetrachloroethylene; 1,2-dichloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane.	(T)	
	二十、製造氧化錫所產生之集塵灰、底渣及其中間產物廢棄物	砷、鉛、錫	arsenic; lead; antimony.	(T)		二十、製造氧化錫所產生之集塵灰、底渣及其中間產物廢棄物	砷、鉛、錫	arsenic; lead; antimony.	(T)	
石油 化工 原料 製造 業及 其他	一、以乙烯製造乙醛之蒸餾殘留物	氯仿、甲醛、氯化次甲基、氯甲烷、三聚乙醛、甲酸、氯乙醛	chloroform; formaldehyde; methylene chloride; methyl chloride; paraldehyde; formic acid; chloroacetaldehyde.	(T)	石油 化工 原料 製造 業及 其他	一、以乙烯製造乙醛之蒸餾殘留物	氯仿、甲醛、氯化次甲基、氯甲烷、三聚乙醛、甲酸、氯乙醛	chloroform; formaldehyde; methylene chloride; methyl chloride; paraldehyde; formic acid; chloroacetaldehyde.	(T)	

修正規定				現行規定				說明		
具有右列製程產生之廢棄物之行業	二、製造丙烯腈中之廢水汽提廢液	丙烯腈、乙腈、氫氰酸	acrylonitrile; acetonitrile; hydrocyanic acid.	(R) (T)	具有右列製程產生之廢棄物之行業	二、製造丙烯腈中之廢水汽提廢液	丙烯腈、乙腈、氫氰酸	acrylonitrile; acetonitrile; hydrocyanic acid.	(R) (T)	
	三、製造丙烯腈中之乙腈塔底部廢液	氫氰酸、丙烯腈、乙腈	hydrocyanic acid; acrylonitrile; acetonitrile.	(R) (T)		三、製造丙烯腈中之乙腈塔底部廢液	氫氰酸、丙烯腈、乙腈	hydrocyanic acid; acrylonitrile; acetonitrile.	(R) (T)	
	四、製造丙烯腈之乙腈純化塔底殘留物	乙腈、丙烯醯胺	acetonitrile; acrylamide.	(T)		四、製造丙烯腈之乙腈純化塔底殘留物	乙腈、丙烯醯胺	acetonitrile; acrylamide.	(T)	
	五、氯苯蒸餾殘渣	氯化甲基苯、氯苯、甲苯、三氯甲苯	benzyl chloride; chlorobenzene; toluene; benzotrichloride.	(T)		五、氯苯蒸餾殘渣	氯化甲基苯、氯苯、甲苯、三氯甲苯	benzyl chloride; chlorobenzene; toluene; benzotrichloride.	(T)	
	六、製造四氯化碳之蒸餾殘渣	六氯苯、六氯丁二烯、四氯化碳、六氯乙烷、四氯乙烯	hexachlorobenzene; hexachlorobutadiene; carbon tetrachloride; hexachloroethane; tetrachloroethylene.	(R) (T)		六、製造四氯化碳之蒸餾殘渣	六氯苯、六氯丁二烯、四氯化碳、六氯乙烷、四氯乙烯	hexachlorobenzene; hexachlorobutadiene; carbon tetrachloride; hexachloroethane; tetrachloroethylene.	(R) (T)	
	七、製造環氧氯化丙烷之純化塔底殘留物	3-氯-1,2-環氧丙烷、含氯醚類〔二氯甲醚、2-氯乙醚〕、三氯丙烷、二氯丙醇	epichlorohydrin; chloroethers[bis(chloromethyl) ether and bis(2-chloroethyl) ethers]; trichloropropane; dichloropropanol.	(T)		七、製造環氧氯化丙烷之純化塔底殘留物	3-氯-1,2-環氧丙烷、含氯醚類〔二氯甲醚、2-氯乙醚〕、三氯丙烷、二氯丙醇	epichlorohydrin; chloroethers[bis(chloromethyl) ether and bis(2-chloroethyl) ethers]; trichloropropane; dichloropropanol.	(T)	

修正規定				現行規定				說明
八、製造氯乙烷之分餾塔重餾分	1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、六氯丁二烯、六氯苯	1,2-dichloroethane; trichloroethylene; hexachlorobutadiene; hexachlorobenzene.	(T)	八、製造氯乙烷之分餾塔重餾分	1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、六氯丁二烯、六氯苯	1,2-dichloroethane; trichloroethylene; hexachlorobutadiene; hexachlorobenzene.	(T)	
九、製造二氯乙烷之蒸餾重餾分	二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷類(1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷)、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、氯仿、氯乙烷、1,1-二氯乙烯	dichloroethane; 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane; tetrachloroethanes (1,1,2,2-tetrachloroethane and 1,1,1,2-tetrachloroethane); trichloroethylene; tetrachloroethylene; carbon tetrachloride; chloroform; vinyl chloride; vinylidene chloride (1,1-DEC).	(T)	九、製造二氯乙烷之蒸餾重餾分	二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷類(1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷)、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、氯仿、氯乙烷、1,1-二氯乙烯	dichloroethane; 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane; tetrachloroethanes (1,1,2,2-tetrachloroethane and 1,1,1,2-tetrachloroethane); trichloroethylene; tetrachloroethylene; carbon tetrachloride; chloroform; vinyl chloride; vinylidene chloride (1,1-DEC).	(T)	

修正規定				現行規定				說明
十、製造氯乙烯單體之氯乙烯蒸餾重餾分	二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷類(1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷)、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、氯仿、氯乙烯、1,1-二氯乙烯	dichloroethane; 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane; tetrachloroethanes (1,1,2,2-tetrachloroethane and 1,1,1,2-tetrachloroethane); trichloroethylene; tetrachloroethylene; carbon tetrachloride; chloroform; vinyl chloride; vinylidene chloride (1,1-DEC).	(T)	十、製造氯乙烯單體之氯乙烯蒸餾重餾分	二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷類(1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷)、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、氯仿、氯乙烯、1,1-二氯乙烯	dichloroethane; 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane; tetrachloroethanes (1,1,2,2-tetrachloroethane and 1,1,1,2-tetrachloroethane); trichloroethylene; tetrachloroethylene; carbon tetrachloride; chloroform; vinyl chloride; vinylidene chloride (1,1-DEC).	(T)	
十一、製造氟甲烷之水溶性銻觸媒廢棄物	銻、四氯化碳、氯仿	antimony; carbon tetrachloride; chloroform.	(T)	十一、製造氟甲烷之水溶性銻觸媒廢棄物	銻、四氯化碳、氯仿	antimony; carbon tetrachloride; chloroform.	(T)	
十二、以異丙苯製造酚及丙酮之蒸餾殘渣	酚、焦油類(多環芳香類)	phenol; tars(polycyclic aromatic hydrocarbons).	(T)	十二、以異丙苯製造酚及丙酮之蒸餾殘渣	酚、焦油類(多環芳香類)	phenol; tars(polycyclic aromatic hydrocarbons).	(T)	
十三、以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐之蒸餾輕餾分	鄰苯二甲酐、順丁烯二酐	phthalic anhydride; maleic anhydride.	(T)	十三、以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐之蒸餾輕餾分	鄰苯二甲酐、順丁烯二酐	phthalic anhydride; maleic anhydride.	(T)	

修正規定				現行規定				說明
十四、以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐之蒸餾殘留物	鄰苯二甲酐	phthalic anhydride.	(T)	十四、以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐之蒸餾殘留物	鄰苯二甲酐	phthalic anhydride.	(T)	
十五、製造三氯乙烷及過氯乙烯之塔底殘留物	六氯苯、六氯丁二烯、六氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、二氯乙烯	hexachlorobezene; hexachlorobutadiene; hexachloroethane; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane; vinylidene chloride.	(T)	十五、製造三氯乙烷及過氯乙烯之塔底殘留物	六氯苯、六氯丁二烯、六氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、二氯乙烯	hexachlorobezene; hexachlorobutadiene; hexachloroethane; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane; vinylidene chloride.	(T)	
十六、以苯硝化製造硝基苯之蒸餾殘留物	間-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯	m-dinitrobenzene; 2,4-dinitrotoluene	(T)	十六、以苯硝化製造硝基苯之蒸餾殘留物	間-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯	m-dinitrobenzene; 2,4-dinitrotoluene	(T)	
十七、製造吡啶所產生之汽提廢棄物	三聚乙醛、吡啶類、2-皮考林	paraldehyde; pyridines; 2-picoline.	(T)	十七、製造吡啶所產生之汽提廢棄物	三聚乙醛、吡啶類、2-皮考林	paraldehyde; pyridines; 2-picoline.	(T)	

修正規定				現行規定				說明
十八、製造1,1,1-三氯乙烷之廢觸媒、汽提廢棄物、蒸餾重餾分及重質廢棄物	1,1,1-三氯乙烷、氯乙烷、1,2-二氯乙烷、二氯乙烯、氯仿、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,1-trichloroethane; vinyl chloride; 1,2-dichloroethane; vinylidene chloride; chloroform; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane.	(T)	十八、製造1,1,1-三氯乙烷之廢觸媒、汽提廢棄物、蒸餾重餾分及重質廢棄物	1,1,1-三氯乙烷、氯乙烷、1,2-二氯乙烷、二氯乙烯、氯仿、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,1-trichloroethane; vinyl chloride; 1,2-dichloroethane; vinylidene chloride; chloroform; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane.	(T)	
十九、製造鄰苯二甲酐之輕質蒸餾殘留物及蒸餾殘留物	鄰苯二甲酐、順丁烯二酐	phthalic anhydride; maleic anhydride.	(T)	十九、製造鄰苯二甲酐之輕質蒸餾殘留物及蒸餾殘留物	鄰苯二甲酐、順丁烯二酐	phthalic anhydride; maleic anhydride.	(T)	
二十、製造氨基甲酸酯之重餾、底渣、輕餾分、溶解過濾傾析等有機廢棄物	免賴得、加保利、貝芬替、加保扶、丁基加保扶、甲醛、二氯甲烷、三乙胺、四氯化碳、吡啶類	benomyl; carbaryl; carbendazim; carbofuran; carbosulfan; formaldehyde; methylene chloride; triethylamine; carbon tetrachloride; pyridine	(T)	二十、製造氨基甲酸酯之重餾、底渣、輕餾分、溶解過濾傾析等有機廢棄物	免賴得、加保利、貝芬替、加保扶、丁基加保扶、甲醛、二氯甲烷、三乙胺、四氯化碳、吡啶類	benomyl; carbaryl; carbendazim; carbofuran; carbosulfan; formaldehyde; methylene chloride; triethylamine; carbon tetrachloride; pyridine	(T)	

修正規定				現行規定				說明		
	二十一、生產聯二 硫氨基甲 酸及其鹽 類於過 濾、蒸發 和離心等 製程之袋 式集塵灰 和殘留物	銻、砷、二 甲基二硫氮 基甲酸鋅	antimony; arsenic; ziram.	(T)		二十一、生產聯二 硫氨基甲 酸及其鹽 類於過 濾、蒸發 和離心等 製程之袋 式集塵灰 和殘留物	銻、砷、二 甲基二硫氮 基甲酸鋅	antimony; arsenic; ziram.	(T)	
	二十二、以氯化汞 觸媒之 乙炔製 程製造 氯乙烯 單體之 廢水處 理污泥	汞	mercury.	(T)		二十二、以氯化汞 觸媒之 乙炔製 程製造 氯乙烯 單體之 廢水處 理污泥	汞	mercury.	(T)	

修正規定			現行規定					說明
二十三、製造二氯 乙烯或 氯乙烯 單體之 廢水處 理污泥	1,2,3,4,6,7,8- 七氯戴奧 辛、 1,2,3,4,6,7,8- 七氯呋喃、 1,2,3,4,7,8,9- 七氯呋喃、 六氯戴奧 辛、六氯呋 喃、五氯戴 奧辛;八氯戴 奧辛、八氯 呋喃、五氯 呋喃、四氯 戴奧辛、四 氯呋喃	1,2,3,4,6,7,8-Heptachl orodibenzo-p-dioxin(1, 2,3,4,6,7,8-HpCDD); 1,2,3,4,6,7,8-Hepta-chl orodibenzofuran (1,2,3,4,6,7,8- HpCDF); 1,2,3,4,7,8,9-Heptachl oro -dibenzofuran (1,2,3,6,7,8,9-HpCDF) ; HxCDDs (All Hexa-chlorodibenzo-p- dioxins); HxCDFs (All Hexachlorodibenzofur ans); PeCDDs (All Pentachlorodibenzo-p- dioxins); OCDD (1,2,3,4,6,7,8,9-Octach lorodibenzo-p-dioxin; OCDF (1,2,3,4,6,7,8,9-Octach lorodibenzo-furan); PeCDFs (All Pentachlorodibenzo-fu rans); TCDDs (All tetrachlorodi-benzo-p- dioxins); TCDFs (All Tetrachlorodibenzo-fur ans).	(T)					一、本項新增。 二、考量現行製造氯乙烯單體之氯乙烯蒸餾重餾分已屬製程有害事業廢棄物，且參考美國製程有害事業廢棄物之管制項目，爰新增本項。

修正規定					現行規定					說明
塗料、漆料及相關產品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	清洗含顏料、乾燥劑、鉻鉛安定劑塗料等配方所用容器內之廢溶劑及污泥、廢鹼及污泥、廢液及污泥	鉛、六價鉻	lead; hexavalent chromium.	(T)	塗料、漆料及相關產品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	清洗含顏料、乾燥劑、鉻鉛安定劑塗料等配方所用容器內之廢溶劑及污泥、廢鹼及污泥、廢液及污泥	鉛、六價鉻	lead; hexavalent chromium.	(T)	
農藥及環境衛生用藥製造業	一、以砷或有機砷製造農藥之殘留物	砷	arsenic.	(T)	農藥及環境衛生用藥製造業	一、以砷或有機砷製造農藥之殘留物	砷	arsenic.	(T)	

修正規定				現行規定				說明	
及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	二、以砷或有機砷化合物生產藥品時蒸餾苯胺化合物產生之蒸餾殘渣或活性碳除色後之殘渣	砷	arsenic.	(T)	二、以砷或有機砷化合物生產藥品時蒸餾苯胺化合物產生之蒸餾殘渣或活性碳除色後之殘渣	砷	arsenic.	(T)	
	三、製造木榴油之廢水處理污泥	木榴油、屈、萘、苯駢萘、苯(a)芘、芘酮(1,2,3-cd)芘、苯(a)駢萘、二苯駢萘(a)駢萘、芘烯	creosote; chrysene; naphthalene; fluoranthene; benzo(b) fluoranthene; benzo(a) pyrene; indeno(1,2,3-cd) pyrene; benzo(a) anthracene; dibenzo(a)anthracene; acenaphthalene.	(T)	三、製造木榴油之廢水處理污泥	木榴油、屈、萘、苯駢萘、苯(a)芘、芘酮(1,2,3-cd)芘、苯(a)駢萘、二苯駢萘(a)駢萘、芘烯	creosote; chrysene; naphthalene; fluoranthene; benzo(b) fluoranthene; benzo(a) pyrene; indeno(1,2,3-cd) pyrene; benzo(a) anthracene; dibenzo(a)anthracene; acenaphthalene.	(T)	
	四、二硫松製造之甲苯回收蒸餾塔底殘留物	甲苯、二硫磷酸、硫磷酸酯類	toluene; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	四、二硫松製造之甲苯回收蒸餾塔底殘留物	甲苯、二硫磷酸、硫磷酸酯類	toluene; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
	五、二硫松製造之廢水處理污泥	甲苯、二硫磷酸、硫磷酸酯類	toluene; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	五、二硫松製造之廢水處理污泥	甲苯、二硫磷酸、硫磷酸酯類	toluene; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	

修正規定				現行規定				說明
六、福瑞松製造之清洗及汽提廢液	福瑞松、甲醛、二硫磷酸、硫磷酸酯類	phorate; formaldehyde; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	六、福瑞松製造之清洗及汽提廢液	福瑞松、甲醛、二硫磷酸、硫磷酸酯類	phorate; formaldehyde; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
七、福瑞松製造之二乙基磷酸氫二硫代硫酸過濾之濾餅	二硫磷酸、硫磷酸酯類	phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	七、福瑞松製造之二乙基磷酸氫二硫代硫酸過濾之濾餅	二硫磷酸、硫磷酸酯類	phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
八、福瑞松製造之廢水處理污泥	福瑞松、甲醛、二硫磷酸、硫磷酸酯類	phorate; formaldehyde; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	八、福瑞松製造之廢水處理污泥	福瑞松、甲醛、二硫磷酸、硫磷酸酯類	phorate; formaldehyde; phosphorodithioic; phosphorothioic acid esters.	(T)	
九、2,4-D製造中之2,6-二氯酚廢棄物	2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、2,4,6-三氯酚	2,4-dichlorophenol; 2,6-dichlorophenol; 2,4,6-trichlorophenol.	(T)	九、2,4-D製造中之2,6-二氯酚廢棄物	2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、2,4,6-三氯酚	2,4-dichlorophenol; 2,6-dichlorophenol; 2,4,6-trichlorophenol.	(T)	
十、2,4-D製造中之未處理廢液	2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚	2,4-dichlorophenol; 2,4,6-trichlorophenol.	(T)	十、2,4-D製造中之未處理廢液	2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚	2,4-dichlorophenol; 2,4,6-trichlorophenol.	(T)	
十一、製造氯丹過程中氯化環二烯之過濾殘渣、浮渣及廢水處理污泥	六氯環戊二烯	Hexachlorocyclopentadiene.	(T)	十一、製造氯丹過程中氯化環二烯之過濾殘渣、浮渣及廢水處理污泥	六氯環戊二烯	Hexachlorocyclopentadiene.	(T)	

修正規定				現行規定				說明
十二、毒殺芬製造之廢水處理污泥	毒殺芬	toxaphene.	(T)	十二、毒殺芬製造之廢水處理污泥	毒殺芬	toxaphene.	(T)	
十三、2,4,5-T製造過程中四氯苯之蒸餾殘渣廢棄物	六氯苯、對二氯苯、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	Hexachlorobenzene; o-dichlorobenzene; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-furans).	(T)	十三、2,4,5-T製造過程中四氯苯之蒸餾殘渣廢棄物	六氯苯、對二氯苯、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	Hexachlorobenzene; o-dichlorobenzene; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-furans).	(T)	
十四、製造乙烯氨基甲酸酯鹽及其鹽類之廢水處理浮渣、濾出液、分離底渣、氣體濃縮底渣、廢過濾器、集塵灰及其殘留物	乙硫脲	ethylene thiourea.	(T)	十四、製造乙烯氨基甲酸酯鹽及其鹽類之廢水處理浮渣、濾出液、分離底渣、氣體濃縮底渣、廢過濾器、集塵灰及其殘留物	乙硫脲	ethylene thiourea.	(T)	
十五、製造溴化甲烷中硫酸乾燥機和反應器產生之廢吸收劑及分離廢水	二甲基硫酸鹽、甲基溴化物	dimethyl sulfate; methyl bromide.	(T)	十五、製造溴化甲烷中硫酸乾燥機和反應器產生之廢吸收劑及分離廢水	二甲基硫酸鹽、甲基溴化物	dimethyl sulfate; methyl bromide.	(T)	

修正規定					現行規定					說明
製藥業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、製造動物用藥所產生之含砷或有機砷化合物之廢水處理污泥	砷	arsenic.	(T)	製藥業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、製造動物用藥所產生之含砷或有機砷化合物之廢水處理污泥	砷	arsenic.	(T)	
	二、以苯胺化合物製造動物用藥所產生之含砷或有機砷化合物之蒸餾殘渣	砷	arsenic.	(T)		二、以苯胺化合物製造動物用藥所產生之含砷或有機砷化合物之蒸餾殘渣	砷	arsenic.	(T)	
	三、製造動物用藥所產生之含砷或有機砷化合物之活性炭脫色渣	砷	arsenic.	(T)		三、製造動物用藥所產生之含砷或有機砷化合物之活性炭脫色渣	砷	arsenic.	(T)	

修正規定					現行規定					說明
其他化學製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、鉛基引爆劑之製造、配方、裝載之廢水處理污泥	鉛	lead.	(T)	其他化學製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、鉛基引爆劑之製造、配方、裝載之廢水處理污泥	鉛	lead.	(T)	
	二、製造鉻黃及鉻橙顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)		二、製造鉻黃及鉻橙顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)	
	三、製造鉬橙顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)		三、製造鉬橙顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)	
	四、製造鋅黃顏料之廢水處理污泥	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)		四、製造鋅黃顏料之廢水處理污泥	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)	
	五、製造鉻綠顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)		五、製造鉻綠顏料之廢水處理污泥	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)	
	六、氧化鉻綠顏料(含水及無水)製造之廢水處理污泥	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)		六、氧化鉻綠顏料(含水及無水)製造之廢水處理污泥	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)	
	七、鐵藍顏料製造之廢水處理污泥	氰化物(錯合物)、六價鉻	cyanide(complexed); hexavalent chromium.	(T)		七、鐵藍顏料製造之廢水處理污泥	氰化物(錯合物)、六價鉻	cyanide(complexed); hexavalent chromium.	(T)	
	八、氧化鉻綠顏料製造之烘箱殘留物	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)		八、氧化鉻綠顏料製造之烘箱殘留物	六價鉻	hexavalent chromium.	(T)	

修正規定					現行規定					說明
	九、使用含鉻和鉛之色素、乾燥劑、肥皂或安定劑製造墨水時，從清洗缸和設備產生之溶劑、鹼洗污泥或污泥	鉛、六價鉻	lead; hexavalent chromium.	(T)		九、使用含鉻和鉛之色素、乾燥劑、肥皂或安定劑製造墨水時，從清洗缸和設備產生之溶劑、鹼洗污泥或污泥	鉛、六價鉻	lead; hexavalent chromium.	(T)	
石油煉製業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、石油煉製業之浮除物	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)	石油煉製業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、石油煉製業之浮除物	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)	
	二、石油煉製業之廢油乳化物	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)		二、石油煉製業之廢油乳化物	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)	
	三、石油煉製業之熱交換器清洗污泥	六價鉻、苯	hexavalent chromium; benzene.	(T)		三、石油煉製業之熱交換器清洗污泥	六價鉻、苯	hexavalent chromium; benzene.	(T)	
	四、石油煉製業油水分離設備產生之污泥	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)		四、石油煉製業油水分離設備產生之污泥	六價鉻、鉛、苯	hexavalent chromium; lead; benzene.	(T)	
	五、石油煉製業加鉛之成品油貯存槽之槽底殘留物	鉛、苯	lead; benzene.	(T)		五、石油煉製業加鉛之成品油貯存槽之槽底殘留物	鉛、苯	lead; benzene.	(T)	
	六、石油煉製業之原油貯槽之槽底沈降物	苯	benzene.	(T)		六、石油煉製業之原油貯槽之槽底沈降物	苯	benzene.	(T)	

修正規定				現行規定				說明		
	七、石油煉製作業之油污槽底泥、過濾或分離之廢棄物	苯(a)芘、二苯(a,h)駢蔥、苯駢(a)蔥、苯(b)駢茈	benzo(a)pyrene; dibenz(a,h)anthracene; benzo(a)anthracene; benzo(b)fluoranthene.	(T)		七、石油煉製作業之油污槽底泥、過濾或分離之廢棄物	苯(a)芘、二苯(a,h)駢蔥、苯駢(a)蔥、苯(b)駢茈	benzo(a)pyrene; dibenz(a,h)anthracene; benzo(a)anthracene; benzo(b)fluoranthene.	(T)	
其他石油及煤製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、煉焦之氨蒸餾塔污泥	氰化物、萘、酚類化合物、砷	cyanide; naphthalene; phenolic compounds; arsenic.	(T)	其他石油及煤製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、煉焦之氨蒸餾塔污泥	氰化物、萘、酚類化合物、砷	cyanide; naphthalene; phenolic compounds; arsenic.	(T)	
	二、煉焦之傾析器塔泥或污泥	酚、萘	phenol; naphthalene.	(T)	其他石油及煤製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	二、煉焦之傾析器塔泥或污泥	酚、萘	phenol; naphthalene.	(T)	
	三、回收煤碳焦油或回收輕油或石腦油精之製程殘渣、焦油貯存槽殘留物	苯、苯(a)駢蔥、苯(a)芘、二苯(b)駢茈、苯(k)駢茈、二苯(a,h)駢蔥、茈酮(1,2,3-cd)芘	benzene; benzo(a)anthracene; benzo(a)pyrene; benzo(b)fluoranthene; benzo(k)fluoranthene; dibenz(a,h)anthracene; indeno(1,2,3-cd)pyrene.	(T)	其他石油及煤製品製造業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	三、回收煤碳焦油或回收輕油或石腦油精之製程殘渣、焦油貯存槽殘留物	苯、苯(a)駢蔥、苯(a)芘、二苯(b)駢茈、苯(k)駢茈、二苯(a,h)駢蔥、茈酮(1,2,3-cd)芘	benzene; benzo(a)anthracene; benzo(a)pyrene; benzo(b)fluoranthene; benzo(k)fluoranthene; dibenz(a,h)anthracene; indeno(1,2,3-cd)pyrene.	(T)	
鋼鐵冶煉業及其他具有右列製程產生之廢	電爐製鋼過程污染控制之集塵灰或污泥	六價鉻、鉛、鎘、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	hexavalent chromium; lead; cadmium; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-furans).	(T)	鋼鐵冶煉業及其他具有右列製程產生之廢	電爐製鋼過程污染控制之集塵灰或污泥	六價鉻、鉛、鎘、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	hexavalent chromium; lead; cadmium; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-furans).	(T)	

修正規定					現行規定					說明
棄物 之 行 業					棄物 之 行 業					
鋼材 表面 處理 業及 其他 具有 右列 製程 產生 之廢 棄物 之 行 業	一、鋼鐵工業鋼材 加工或浸置 之廢酸液	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)	鋼材 表面 處理 業及 其他 具有 右列 製程 產生 之廢 棄物 之 行 業	一、鋼鐵工業鋼材 加工或浸置 之廢酸液	六價鉻、鉛	hexavalent chromium; lead.	(T)	
	二、鐵鉻合金製程 之排放控制 之集塵灰或 污泥	鉻	chromium.	(C) (T)	鋼材 表面 處理 業及 其他 具有 右列 製程 產生 之廢 棄物 之 行 業	二、鐵鉻合金製程 之排放控制 之集塵灰或 污泥	鉻	chromium.	(C) (T)	
	三、鐵鉻矽合金製 造之排放控 制之集塵灰 或污泥	鉻	chromium.	(C) (T)	鋼材 表面 處理 業及 其他 具有 右列 製程 產生 之廢 棄物 之 行 業	三、鐵鉻矽合金製 造之排放控 制之集塵灰 或污泥	鉻	chromium.	(C) (T)	

修正規定					現行規定					說明
其他非鐵金屬基本工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、鉛、鎳、汞、鎘、銅二次熔煉之排放控制之集塵灰或污泥	六價鉻、鉛、鎘、汞、鎳、銅	hexavalent chromium; lead; cadmium; mercury; nickel; lead.	(T)	其他非鐵金屬基本工業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、鉛、鎳、汞、鎘、銅二次熔煉之排放控制之集塵灰或污泥	六價鉻、鉛、鎘、汞、鎳、銅	hexavalent chromium; lead; cadmium; mercury; nickel; lead.	(T)	配合附表二之刪除移列並修正管制項目
	二、鉛二次熔煉之排放控制之集塵灰、污泥之酸滲出液	六價鉻、鉛、鎘	hexavalent chromium; lead; cadmium.	(T)		二、鉛二次熔煉之排放控制之集塵灰、污泥之酸滲出液	六價鉻、鉛、鎘	hexavalent chromium; lead; cadmium.	(T)	
	三、製造初生銅所排放之泥漿濃縮酸廠排放之泥漿或污泥	鉛、鎘	lead; cadmium.	(T)		三、製造初生銅所排放之泥漿濃縮酸廠排放之泥漿或污泥	鉛、鎘	lead; cadmium.	(T)	
	四、初生鋁還原時用過之缸內襯物質	氰化物(錯合物)	cyanide(complexed).	(T)		四、初生鋁還原時用過之缸內襯物質	氰化物(錯合物)	cyanide(complexed).	(T)	
廢棄物處理業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、含汞廢料回收產生之殘渣或污泥	汞	mercury.	(T)	廢棄物處理業及其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、含汞廢料回收產生之殘渣或污泥	汞	mercury.	(T)	
	二、廢料回收產生之金屬固體殘留物	鉛、鎘、鉻、銻、錒、碲、鉍	lead; cadmium; chromium; beryllium; antimony; tellurium; thallium.	(T)		二、廢料回收產生之金屬固體殘留物	鉛、鎘、鉻	lead; cadmium; chromium.	(T)	
	三、廢料回收產生之酸性廢液或污泥	銅、鉛、鎘、鉻	copper; lead; cadmium; chromium.	(T)		三、廢料回收產生之酸性廢液或污泥	銅、鉛、鎘、鉻	copper; lead; cadmium; chromium.	(T)	

修正規定					現行規定					說明
	四、廢電線電纜粉碎分選回收產生之集塵灰	銅、鉛	copper; lead.	(T)		四、廢電線電纜粉碎分選回收產生之集塵灰	銅、鉛	copper; lead.	(T)	
	五、廢料回收產生之廢螢光粉	汞、鉛	mercury; lead.	(T)		五、廢料回收產生之廢螢光粉	汞、鉛	mercury; lead.	(T)	
其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、電鍍製程之廢水處理污泥,但下述製程所發生者除外: (一)鋁之硫酸電鍍 (二)碳鋼鍍錫。 (三)碳鋼鍍鋁。 (四)伴隨清洗或汽提之碳鋼錫、鋁。 (五)鋁之蝕刻及研磨。	鎘、六價鉻、鎳、氰化物(錯合物)、銅	cadmium; hexavalent chromium; nickel; cyanide(complexed); copper.	(T)	其他具有右列製程產生之廢棄物之行業	一、電鍍製程之廢水處理污泥,但下述製程所發生者除外: (一)鋁之硫酸電鍍 (二)碳鋼鍍錫。 (三)碳鋼鍍鋁。 (四)伴隨清洗或汽提之碳鋼錫、鋁。 (五)鋁之蝕刻及研磨。	鎘、六價鉻、鎳、氰化物(錯合物)、銅	cadmium; hexavalent chromium; nickel; cyanide(complexed); copper.	(T)	
	二、鋁之化學轉化塗布製程之廢水處理污泥	六價鉻、氰化物(錯合物)	hexavalent chromium; cyanide(complexed).	(T)		二、鋁之化學轉化塗布製程之廢水處理污泥	六價鉻、氰化物(錯合物)	hexavalent chromium; cyanide(complexed).	(T)	
	三、電鍍廢棄之氰化物電鍍液	氰化物(鹽類)	cyanide (salts).	(T)		三、電鍍廢棄之氰化物電鍍液	氰化物(鹽類)	cyanide (salts).	(T)	
	四、使用氰化物之電鍍程序電鍍槽底殘留物	氰化物(鹽類)	cyanide (salts).	(T)		四、使用氰化物之電鍍程序電鍍槽底殘留物	氰化物(鹽類)	cyanide (salts).	(T)	

修正規定				現行規定				說明
五、使用氰化物之電鍍程序清洗及汽提廢液	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).	(T)	五、使用氰化物之電鍍程序清洗及汽提廢液	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).	(T)	配合附表二之刪除，新增管制項目
六、使用氰化物之金屬熱處理油槽之冷卻槽殘留物	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).	(T)	六、使用氰化物之金屬熱處理油槽之冷卻槽殘留物	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).	(T)	
七、金屬熱處理槽鹽浴罐清洗之氰化物廢液	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).	(T)	七、金屬熱處理槽鹽浴罐清洗之氰化物廢液	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).	(T)	
八、使用氰化物之金屬熱處理程序之冷卻廢水處理污泥	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).	(T)	八、使用氰化物之金屬熱處理程序之冷卻廢水處理污泥	氰化物（鹽類）	cyanide (salts).	(T)	
九、使用熱處理法處理有害事業廢棄物所產生之集塵灰	鉛、鎘、鉻、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	lead; cadmium; chromium.; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-furans).	(T)	九、使用熱處理法處理有害事業廢棄物所產生之集塵灰	鉛、鎘、鉻、2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物	lead; cadmium; chromium.; 2,3,7,8-TCDD (All tetrachlorodibenzo-p-dioxins)&TCDF(All tetrachlorodibenzo-furans).	(T)	
十、砷化鎵半導體製程產生之晶圓廢料及粉屑	砷	arsenic	(T)	註：危害性表示：(I)：易燃性；(C)：腐蝕性；(R)反應性；(T)：毒性。				

有害事業廢棄物認定標準第三條附表二修正條文對照表

修正規定	現行規定	說明																																																																											
	附表二、不同清理階段之混合五金廢料認定對照表																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 65%;">廢棄物項目分類</th> <th style="width: 8%;">貯存階段</th> <th style="width: 8%;">清除階段</th> <th style="width: 12%;">處理階段 (含再利用)</th> <th style="width: 8%;">輸出入境</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、廢電線電纜(非以物理處理法處理者)</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>二、含油脂之充膠廢電線電纜</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>三、不含多氯聯苯(低於五十 ppm)但含油脂之廢變壓器、廢電容器</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>四、電鍍金屬廢塑膠(含光碟片)</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>五、廢電腦</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>六、廢家電</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>七、廢電話交換機</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>八、廢電子零組件、下腳品及不良品</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>九、廢光電零組件、下腳品及不良品</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>十、廢通信器材(不含機械式)</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>十一、含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>十二、附零組件之廢印刷電路板</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>十三、含鉍、銻、碲、鉈金屬廢料</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">一般</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> <tr> <td>十四、發光二極體晶圓廢料及粉屑</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> <td style="text-align: center;">有害</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註：一、下腳品係指事業因成型或構裝等過程產生之廢料。 二、零組件係指事業因過期或品質管制汰換等過程產生之廢料。 三、不良品係指事業因品質管制或其他原因所淘汰之廢棄成品。</p>	廢棄物項目分類	貯存階段	清除階段	處理階段 (含再利用)	輸出入境	一、廢電線電纜(非以物理處理法處理者)	一般	一般	有害	有害	二、含油脂之充膠廢電線電纜	一般	一般	有害	有害	三、不含多氯聯苯(低於五十 ppm)但含油脂之廢變壓器、廢電容器	一般	一般	有害	有害	四、電鍍金屬廢塑膠(含光碟片)	一般	一般	有害	有害	五、廢電腦	一般	一般	有害	有害	六、廢家電	一般	一般	有害	有害	七、廢電話交換機	一般	一般	有害	有害	八、廢電子零組件、下腳品及不良品	一般	一般	有害	有害	九、廢光電零組件、下腳品及不良品	一般	一般	有害	有害	十、廢通信器材(不含機械式)	一般	一般	有害	有害	十一、含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑	一般	一般	有害	有害	十二、附零組件之廢印刷電路板	一般	一般	有害	有害	十三、含鉍、銻、碲、鉈金屬廢料	一般	一般	有害	有害	十四、發光二極體晶圓廢料及粉屑	有害	有害	有害	有害	<p>一、本表刪除。</p> <p>二、回歸巴塞爾公約對有害廢棄物之管制精神(列入清單 A 且呈現附件三之有害特性，方認定為有害廢棄物)，故刪除附表二以與國際管制方式接軌。</p> <p>三、將原附表二第十三項含鉍、銻、碲、鉈金屬廢料、第十四項發光二極體晶圓廢料及粉屑移列至附表一進行管制。</p>
廢棄物項目分類	貯存階段	清除階段	處理階段 (含再利用)	輸出入境																																																																									
一、廢電線電纜(非以物理處理法處理者)	一般	一般	有害	有害																																																																									
二、含油脂之充膠廢電線電纜	一般	一般	有害	有害																																																																									
三、不含多氯聯苯(低於五十 ppm)但含油脂之廢變壓器、廢電容器	一般	一般	有害	有害																																																																									
四、電鍍金屬廢塑膠(含光碟片)	一般	一般	有害	有害																																																																									
五、廢電腦	一般	一般	有害	有害																																																																									
六、廢家電	一般	一般	有害	有害																																																																									
七、廢電話交換機	一般	一般	有害	有害																																																																									
八、廢電子零組件、下腳品及不良品	一般	一般	有害	有害																																																																									
九、廢光電零組件、下腳品及不良品	一般	一般	有害	有害																																																																									
十、廢通信器材(不含機械式)	一般	一般	有害	有害																																																																									
十一、含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑	一般	一般	有害	有害																																																																									
十二、附零組件之廢印刷電路板	一般	一般	有害	有害																																																																									
十三、含鉍、銻、碲、鉈金屬廢料	一般	一般	有害	有害																																																																									
十四、發光二極體晶圓廢料及粉屑	有害	有害	有害	有害																																																																									

有害事業廢棄物認定標準第三條附表二修正條文對照表

修正規定		現行規定		說明
附表二、醫療有害廢棄物		附表三、生物醫療廢棄物		
項目	成分與說明	項目	成分與說明	
一、基因毒性廢棄物		一、基因毒性廢棄物		
(一)屬致癌之細胞毒素或其他藥物	azathioprine, chlorambucil(氮芥苯丁酸), chlornaphazine, ciclosporin, cyclophosphamide(環磷醯胺), melphalan(氮芥苯丙胺酸), semustine, tamoxifen(它莫西芬), thiotepa(沙奧特帕), treosulfan.	(一)屬致癌之細胞毒素或其他藥物	azathioprine, chlorambucil(氮芥苯丁酸), chlornaphazine, ciclosporin, cyclophosphamide(環磷醯胺), melphalan(氮芥苯丙胺酸), semustine, tamoxifen(它莫西芬), thiotepa(沙奧特帕), treosulfan.	
(二)可能致癌之細胞毒素或其他藥物	azacitidine, bleomycin, carmustine, chloramphenicol(氯絲菌素), chlorozotocin, cisplatin, dacarbazine, daunorubicin(道諾魯比辛), dihydroxymethylfuratrizine, doxorubicin(杜薩魯比辛), lomustine, methylthiouracil(鉀硫脲酮), metronidazole(硝基甲嘧唑乙醇), mitomycin, nafenopin, niridazole, oxazepam(歐沙氮平), phenacetin(非那西汀), phenobarbital(苯巴比妥), phenytoin(二苯妥因), procarbazine hydrochloride, progesterone(黃體素), sarcolysin, streptozocin, trichlormethine.	(二)可能致癌之細胞毒素或其他藥物	azacitidine, bleomycin, carmustine, chloramphenicol(氯絲菌素), chlorozotocin, cisplatin, dacarbazine, daunorubicin(道諾魯比辛), dihydroxymethylfuratrizine, doxorubicin(杜薩魯比辛), lomustine, methylthiouracil(鉀硫脲酮), metronidazole(硝基甲嘧唑乙醇), mitomycin, nafenopin, niridazole, oxazepam(歐沙氮平), phenacetin(非那西汀), phenobarbital(苯巴比妥), phenytoin(二苯妥因), procarbazine hydrochloride, progesterone(黃體素), sarcolysin, streptozocin, trichlormethine.	

修正規定		現行規定		說明
二、廢尖銳器具	指對人體會造成刺傷或切割傷之廢棄物品，包括注射針頭、與針頭相連之注射筒及輸液導管、針灸針、手術縫合針、手術刀、載玻片、蓋玻片或破裂之玻璃器皿等。	二、廢尖銳器具	指對人體會造成刺傷或切割傷之廢棄物品，包括注射針頭、與針頭相連之注射筒及輸液導管、針灸針、手術縫合針、手術刀、載玻片、蓋玻片或破裂之玻璃器皿等。	修正款次名稱以資明確。
三、感染性廢棄物		三、感染性廢棄物		
(一)廢棄之微生物培養物、菌株及相關生物製品	指廢棄之培養物、菌株、活性疫苗、培養皿或相關用具，及感染性生物材料製造過程產生之廢棄物。	(一)廢棄之微生物培養物、菌株及相關生物製品	指廢棄之培養物、菌株、活性疫苗、培養皿或相關用具，及感染性生物材料製造過程產生之廢棄物。	
(二)病理廢棄物	指手術或驗屍所取出之人體組織、器官、殘肢、體液等。但不含頭顱、屍體、頭髮、指甲及牙齒。	(二)病理廢棄物	指手術或驗屍所取出之人體組織、器官、殘肢、體液等。但不含頭顱、屍體、頭髮、指甲及牙齒。	
(三)血液廢棄物	指廢棄之人體血液或血液製品，包括血餅、血清、血漿及其他血液組成分。	(三)血液廢棄物	指廢棄之人體血液或血液製品，包括血餅、血清、血漿及其他血液組成分。	
(四)實驗用動物屍體、殘肢及墊料	指接受微生物感染之實驗動物屍體、殘肢及其墊料，包括經檢疫後廢棄或因病死亡者。	(四)受污染動物屍體、殘肢及墊料	指接受微生物感染之實驗動物屍體、殘肢及其墊料，包括經檢疫後廢棄或因病死亡者。	
(五)手術或驗屍廢棄物	指使用於外科手術治療、驗屍或解剖行為而廢棄之衣物、紗布、覆蓋物、排泄用具、褥墊、手術用手套。	(五)手術或驗屍廢棄物	指使用於外科手術治療、驗屍或解剖行為而廢棄之衣物、紗布、覆蓋物、排泄用具、褥墊、手術用手套。	
(六)實驗室廢棄物	1.生物安全等級第三級及第四級實驗室所產生之廢棄物皆屬之。 2.生物安全等級第二級實驗室中與微生物接觸之廢棄物，包括拋棄式接種環及接種針、檢體、手套、實驗衣、拋棄式隔離衣等。	(六)實驗室廢棄物	1.生物安全等級第三級及第四級實驗室所產生之廢棄物皆屬之。 2.生物安全等級第二級實驗室中與微生物接觸之廢棄物，包括拋棄式接種環及接種針、檢體、手套、實驗衣、拋棄式隔離衣等。	

修正規定		現行規定		說明
(七)透析廢棄物	指進行血液透析時與病人血液接觸之廢棄物，包括拋棄式導管、濾器、手巾、床單、手套、拋棄式隔離衣、實驗衣等。	(七)透析廢棄物	指進行血液透析時與病人血液接觸之廢棄物，包括拋棄式導管、濾器、手巾、床單、手套、拋棄式隔離衣、實驗衣等。	
(八)隔離廢棄物	指收容患傳染病病人之隔離病房所產出之廢棄物。	(八)隔離廢棄物	指收容患傳染病病人之隔離病房所產出之廢棄物。	
(九)受血液及體液污染廢棄物	指其他醫療行為所產生與病人血液、體液、引流液或排泄物接觸之廢棄物，包括各類廢棄之蛇型管、氧氣鼻導管、抽痰管、導尿管、引流管等，及沾有可流動人體血液、精液、陰道分泌物、腦脊髓液、滑液、胸膜液、腹膜液、心包液或羊水且可能導致滴濺之廢棄物。但不含止血棉球、使用過之個人衛生用品、沾有不可流動或不可吸收之人體分泌物的紗布、包紮物、尿布、面紙及廁所衛生紙等。	(九)受血液及體液污染廢棄物	指其他醫療行為所產生與病人血液、體液、引流液或排泄物接觸之廢棄物，包括各類廢棄之蛇型管、氧氣鼻導管、抽痰管、導尿管、引流管等，及沾有可流動人體血液、精液、陰道分泌物、腦脊髓液、滑液、胸膜液、腹膜液、心包液或羊水且可能導致滴濺之廢棄物。但不含止血棉球、使用過之個人衛生用品、沾有不可流動或不可吸收之人體分泌物的紗布、包紮物、尿布、面紙及廁所衛生紙等。	
四、其他經中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定對人體或環境具危害性，並經公告者。		四、其他經中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定對人體或環境具危害性，並經公告者。		

有害事業廢棄物認定標準第四條附表三修正條文對照表

修正規定			現行規定			說明
附表三、毒性特性溶出程序(TCLP)溶出標準			附表四、毒性特性溶出程序(TCLP)溶出標準			表次遞改。
分析項目	英文名稱	溶出試驗標準(毫克/公升)	分析項目	英文名稱	溶出試驗標準(毫克/公升)	
一、農藥污染物			一、農藥污染物			
(一)有機氯劑農藥	Organic Chloride pesticides	○·五	(一)有機氯劑農藥	Organic Chloride pesticides	○·五	
(二)有機磷劑農藥	Organic Phosphorous pesticides	二·五	(二)有機磷劑農藥	Organic Phosphorous pesticides	二·五	
(三)氨基甲酸鹽農藥	Carbamates pesticides	二·五	(三)氨基甲酸鹽農藥	Carbamates pesticides	二·五	
二、有機性污染物			二、有機性污染物			
(一)六氯苯	Hexachlorobenzene	○·一三	(一)六氯苯	Hexachlorobenzene	○·一三	
(二)2,4-二硝基甲苯	2,4-Dinitrotoluene	○·一三	(二)2,4-二硝基甲苯	2,4-Dinitrotoluene	○·一三	
(三)氯乙烯	Vinyl chloride	○·二	(三)氯乙烯	Vinyl chloride	○·二	
(四)苯	Benzene	○·五	(四)苯	Benzene	○·五	
(五)四氯化碳	Carbon tetrachloride	○·五	(五)四氯化碳	Carbon tetrachloride	○·五	
(六)1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane	○·五	(六)1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane	○·五	
(七)六氯-1,3-丁二烯	Hexachlorobutadiene	○·五	(七)六氯-1,3-丁二烯	Hexachlorobutadiene	○·五	
(八)三氯乙烯	Trichloroethylene	○·五	(八)三氯乙烯	Trichloroethylene	○·五	
(九)1,1-二氯乙烯	1,1-Dichloroethylene	○·七	(九)1,1-二氯乙烯	1,1-Dichloroethylene	○·七	
(十)四氯乙烯	Tetrachloroethylene	○·七	(十)四氯乙烯	Tetrachloroethylene	○·七	
(十一)2-(2,4,5-三氯酚丙酸)	2-(2,4,5-TP) (Silvex)	一·○	(十一)2-(2,4,5-三氯酚丙酸)	2-(2,4,5-TP) (Silvex)	一·○	
(十二)2,4,6-三氯酚	2,4,6-Trichlorophenol	二·○	(十二)2,4,6-三氯酚	2,4,6-Trichlorophenol	二·○	

修正規定			現行規定			說明
(十三)硝基苯	Nitrobenzene	二・〇	(十三)硝基苯	Nitrobenzene	二・〇	
(十四)六氯乙烷	Hexachloroethane	三・〇	(十四)六氯乙烷	Hexachloroethane	三・〇	
(十五)吡啶	Pyridine	五・〇	(十五)吡啶	Pyridine	五・〇	
(十六)氯仿	Chloroform	六・〇	(十六)氯仿	Chloroform	六・〇	
(十七)1,4-二氯苯	1,4-Dichlorobenzene	七・五	(十七)1,4-二氯苯	1,4-Dichlorobenzene	七・五	
(十八)2,4-二氯苯 氧乙酸	2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	一〇・〇	(十八)2,4-二氯苯 氧乙酸	2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	一〇・〇	
(十九)氯苯	Chlorobenzene	一〇〇・〇	(十九)氯苯	Chlorobenzene	一〇〇・〇	
(二十)五氯酚	Pentachlorophenol	一〇〇・〇	(二十)五氯酚	Pentachlorophenol	一〇〇・〇	
(二十一)總甲酚	Cresol	二〇〇・〇	(二十一)總甲酚	Cresol	二〇〇・〇	
(二十二)丁酮	Methyl ethyl ketone	二〇〇・〇	(二十二)丁酮	Methyl ethyl ketone	二〇〇・〇	
(二十三)2,4,5-三氯 酚	2,4,5-Trichlorophenol	四〇〇・〇	(二十三)2,4,5-三氯 酚	2,4,5-Trichlorophenol	四〇〇・〇	
三、有毒重金屬			三、有毒重金屬			
(一)汞及其化合物 (總汞)	Mercury and Mercury compounds	〇・二	(一)汞及其化合物 (總汞)	Mercury and Mercury compounds	〇・二	
(二)鎘及其化合物 (總鎘)	Cadmium and Cadmium compounds	一・〇	(二)鎘及其化合物 (總鎘)	Cadmium and Cadmium compounds	一・〇	
(三)硒及其化合物 (總硒)	Selenium and Selenium compounds	一・〇	(三)硒及其化合物 (總硒)	Selenium and Selenium compounds	一・〇	
(四)六價鉻化合物	Hexavalent chromium	二・五	(四)六價鉻化合物	Hexavalent chromium	二・五	
(五)鉛及其他化合物 (總鉛)	Lead and Lead compounds	五・〇	(五)鉛及其他化合物 (總鉛)	Lead and Lead compounds	五・〇	
(六)鉻及其化合物 (總鉻)(不包含 製造或使用動 物皮革程序所 產生之廢皮	Chromium and Chromium compounds	五・〇	(六)鉻及其化合物 (總鉻)(不包含 製造或使用動 物皮革程序所 產生之廢皮	Chromium and Chromium compounds	五・〇	

修正規定			現行規定			說明
粉、皮屑及皮塊)			粉、皮屑及皮塊)			
(七)砷及其化合物 (總砷)	Arsenic and Arsenic compounds	五·○	(七)砷及其化合物 (總砷)	Arsenic and Arsenic compounds	五·○	
(八)銀及其化合物 (總銀)(僅限攝影沖洗及照相製版廢液)	Silver and Silver compounds	五·○	(八)銀及其化合物 (總銀)(僅限攝影沖洗及照相製版廢液)	Silver and Silver compounds	五·○	
(九)銅及其化合物 (總銅)(僅限廢觸媒、集塵灰、廢液、污泥、濾材、焚化飛灰或底渣、 <u>混合五金廢料處理後之殘餘物。</u>)	Copper and Copper compounds	一五·○	(九)銅及其化合物 (總銅)(僅限廢觸媒、集塵灰、廢液、污泥、濾材、焚化飛灰或底渣)	Copper and Copper compounds	一五·○	配合附表二之刪除，並強化混合五金廢料處理後殘餘物之管理，爰於三、(九)增列混合五金廢料處理後之殘餘物。
(十)鋇及其化合物 (總鋇)	Barium and Barium compounds	一〇〇·○	(十)鋇及其化合物 (總鋇)	Barium and Barium compounds	一〇〇·○	

附件

製程有害事業廢棄物排除認定 申請書

事業名稱：_____

申請日期：_____年 月 日

壹、基本資料表

一、廠商基本資料				
廠商名稱				
聯絡地址				
負責人姓名				
聯絡人		聯絡人電話		
聯絡人傳真		聯絡人 e-mail		
事業管制編號				
工廠地址				
事業之公司登記證明文件或商業登記證明文件(以附件方式置於本申請書之後面)				
二、申請排除認定之廢棄物基本資料				
廢棄物名稱		廢棄物網路申報代碼		
行業別			請依有害事業廢棄物認定標準附表一內容填寫	
製程產生之廢棄物				
廢棄物所含有害成分				
申請排除認定廢棄物該製程原物料之使用情形說明				
原料及添加物名稱	使用量 (公噸/月)			特殊單位 (如無法以重量表示,再以特殊單位表示)
	月最大值	月最小值	月平均值	

貳、申請原因

申請排除認定之理由

請詳實說明符合製程有害事業廢棄物排除認定之理由。(請以流程圖或照片輔助說明)

參、廢棄物採樣計畫書及檢測報告

- 1.請依「事業廢棄物檢測方法總則」及「事業廢棄物採樣方法」進行採樣與分析。另事業廢棄物之檢測頻率及檢測項目須依照「有害事業廢棄物檢測及紀錄管理辦法」之規定辦理。
- 2.廢棄物特性、組成及成分分析：請依所提出排除認定申請之廢棄物，於「有害事業廢棄物認定標準」附表一製程有害事業廢棄物所列之有害成分進行廢棄物總量分析，並檢具成分分析報告，檢測報告之日期須為申請日前一年內。
- 3.本採樣計畫書及檢測報告，請以附件方式置於本申請書之後面。

肆、切結聲明

立書人：(公司名稱) 及負責人：_____，茲依據有害事業廢棄物認定標準第六條之規定，檢具製程有害事業廢棄物排除認定申請書送審，經核准後，本公司將確實遵守廢棄物清理法及其他相關法令之規定，定期檢測並妥善清除、處理有害事業廢棄物，如有違法，願受處分。

立書人保證所檢具之文書及提供之相關資料，均無涉及偽造、不實情事，如經查獲涉有虛假不實情事，將受廢棄物清理法第四十八條規定，判處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。

公司名稱：_____ (公司蓋章)

立書人：_____ (公司負責人蓋章)

公司地址：_____

此致

○○縣(市)政府

中華民國 年 月 日